**周总结**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **周几** | **实验内容（要具体）** | **备注（存的问题，文献，想法）** |
| 8.20 | 一 | 1、清洗硅片（浓硫酸双氧水加热浸泡清洗）  2、清洗石英片（浓硫酸双氧水加热浸泡清洗） |  |
| 8.21 | 二 | 1、硅片封装好邮寄出去。  2、石英片转移AAO薄膜，尝试小片转移失败，泡丙酮时候脱落。 |  |
| 8.22 | 三 | 1、重新清洗石英片（丙酮、乙醇、去离子水超声清洗）  2、尝试长条形转移，也失败了两片，原因可能是AAO和基底吸附不牢固。  3、测试软件调试。怀疑出现问题。 | 因为测试软件两张图谱的横坐标不同，所以在来回看原始光谱和透射光谱的时候，以为透射吸收峰在500nm左右，实际上在625nm左右，从而怀疑算法有问题。周五早上重新去检查之后才意识到算法没有问题，是自己看错了。 |
| 8.23 | 四 | 1、继续AAO转移。  2、组会和组会PPT。 |  |
| 8.24 | 五 | 1、检查算法问题。并通过平滑算法，得到比较稳定的透射吸收峰位置，目前在长时间内，透射吸收峰峰位变化约1nm左右。但是积分算法仍然不能稳定。  2、继续AAO转移。 | 实际上积分算法的周期性变化不是吸收峰峰位变了，而是光强变化了。光强变化的原因有很多种，光源发热、光学平台震动、光谱仪发热等原因都会导致。 |

本周工作：1、清洗硅片和石英片进行实验。2、硅片邮寄给公司转移二维材料。3、石英片上转移AAO薄膜，并解决AAO薄膜与基底贴合不紧密的问题。4、测试系统进一步修正。

下周计划：1、转移二维材料。2、光刻图形，将二维材料刻成3\*3阵列，解决后续键合时二维材料影响键合。3、使用九孔金属板作为掩模蒸金。